

V03a IBS法による広帯域反射防止膜の開発

和瀬田幸一、大橋正健、唐牛宏(国立天文台)、上田暁俊(電通大)

天文台の Ion Beam Sputter 型誘電体多層膜作成装置を用いて広帯域の反射防止膜の開発を行っている。この型の装置はフッ化物を製膜することが困難なので、低屈折率物質として SiO₂ しかなく、その点では反射防止膜の製作には不向きである。しかし、超多層の膜を製作可能であり正確な膜厚制御が可能という利点を活かして高性能化する可能性を探っている。講演では、現在まで行ってきた設計、膜厚制御、再現性の維持、屈折率測定技術などについて述べる。